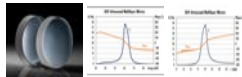


Flacher, mehrlagiger EUV-Attosekunden-Spiegel, 25,4 mm Durchmesser, 65 eV, 5°

Mehr Produkte von [UltraFast Innovations \(UFI\)](#)



UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors



Produkt #16-765 **4 In Stock**

- 1 + €2.520⁰⁰

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1+	€2.520,00 stückpreis
Need More?	Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Produktdetails

Flat Mirror **Typ:**

XUV65BW6 **Modellnummer:**

330 attoseconds **Mögliche Pulsdauer:**

Physikalische und mechanische Eigenschaften

25.40 ±0.13 **Durchmesser (mm):**

Commercial Polish **Rückseite:**

80 **Freie Apertur (%):**

6.35 ±0.20 **Randdicke ET (mm):**

Fine Ground **Kanten:**

<1 **Parallelität (Bogenminuten):**

<1 **Oberflächenrauheit (Ångström):**

Optische Eigenschaften

EUV Multilayer (19nm) **Beschichtung:**

M10 **Oberflächenebenheit (P-V):**

19 **Designwellenlänge DWL (nm):**

[Fused Silica](#) (Corning 7980) **Substrat:**

5 **Einfallswinkel (°):**

Rs > 38% @ 65eV/19nm **Beschichtungsspezifikation:**

>38 **Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):**

Elektronische Spezifikationen

65 ±2 **Zentralenergie (eV):**

6 **Bandbreite (eV):**

Konformität mit Standards

[Konform](#) **RoHS 2015:**

[Anzeigen](#) **Konformitätszertifikat:**

[Konform](#) **Reach 235:**

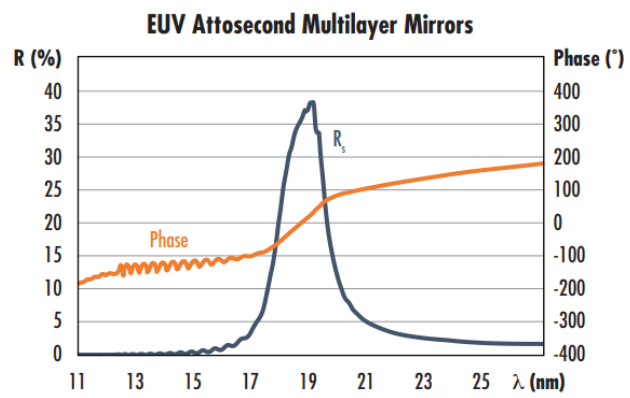
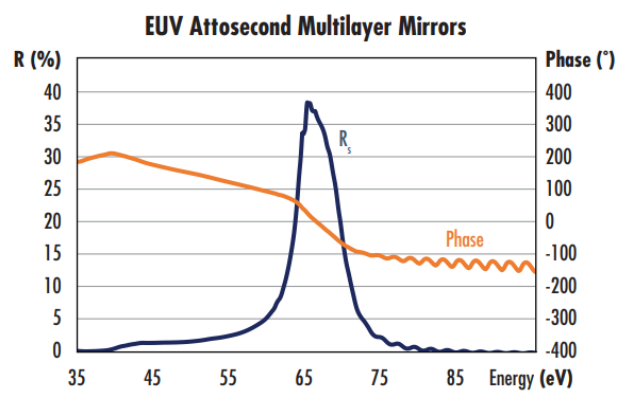
Produktdetails

- Entwickelt für Pulse mit 330 Attosekunden @ 65 eV (19 nm)
- Mehrlagige Beschichtung mit 38% Spitzenreflexion
- Superpolierte Substrate mit ≤1 Å (Ångström) Oberflächenrauheit
- [EUV-Planspiegel](#) und [sphärische EUV-Spiegel](#) für 13,5 nm sind ebenfalls verfügbar
- Lagernd
- Keine Mindestbestellmenge und kein Mindestbestellwert

Mehrlagige EUV/XUV-Attosekunden-Spiegel von UltraFast Innovations (UFI) für das extreme Ultraviolett sind für die Lenkung, Fokussierung und Formung von Attosekunden-Pulsen entwickelt worden. Die mehrlagige Beschichtung ist bei 65 eV (19 nm) zentriert und hat eine Bandbreite von 6 eV (1,8 nm). Sie bietet eine Spitzenreflexion von 38% für s-polarisiertes Licht. Die Spiegel können für EUV-Pulse mit einer zeitlichen Dauer von 330 Attosekunden eingesetzt werden. Mehrlagige EUV/XUV-Attosekunden-Spiegel sind ideal für die Erzeugung und Formung von Attosekunden-Pulsen basierend auf High Harmonic Generation (HHG), Freien-Elektronen-Lasern (FELs) oder anderen quantenoptischen Anwendungen.

Die atomare Präzision der Ionenstrahlbeschichtung führt zu atomar glatten Beschichtungslagen. Die Spiegel ermöglichen eine präzise Kontrolle von Wellenlänge und spektraler Phase mit hoher Effizienz für einen wachsenden Anwendungsbereich. Die Attosekunden-Wissenschaften setzen neue Maßstäbe für Ultrakurzpuls-Laser und ermöglichen Zugang zu den grundlegendsten wissenschaftlichen Prozessen wie der Bewegung von Elektronen. EUV-Spiegel werden auch als XUV-Spiegel oder Spiegel für weiche Röntgenstrahlen bezeichnet. Das physikalische Prinzip hinter den mehrlagigen EUV-Attosekunden-Spiegeln ist die Interferenz von reflektierter und gestreuter EUV-Strahlung von jeder Oberfläche der einzelnen Lagen. Es sind flache und konkave Spiegel mit 25,4 mm Durchmesser verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen mehrlagigen Spiegel mit kundenspezifischer Zentralenergie, Bandbreite oder anderer Spezifikation benötigen.

Technische Informationen



Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem [Wissens-Zentrum](#) finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine [E-Mail](#) oder [chatten Sie](#) mit unserem technischen Support.



Werkzeuge zur Handhabung von Komponenten

Kompatible Halterungen